

# DIN 50455-1:2009-10 (D)

## Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken - Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit optischen Messverfahren

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Kurzbeschreibung .....	4
4 Einheiten .....	4
5 Geräte und Materialien .....	5
6 Durchführung .....	5
6.1 Allgemeines .....	5
6.2 Probenherstellung .....	6
6.2.1 Umgebungsbedingungen .....	6
6.2.2 Herstellverfahren .....	6
6.3 Messung der Schichtdicke .....	6
7 Auswertung .....	7
7.1 Allgemeines .....	7
7.2 Absolutverfahren .....	7
7.3 Differenzverfahren .....	8
8 Präzision .....	8
9 Prüfbericht .....	8
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Beispiel eines Messstellenplanes .....</b>	<b>7</b>